

© 1992

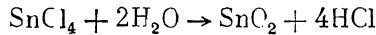
## ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ЭКСИТОНОВ В КРИСТАЛЛАХ ДВУОКИСИ ОЛОВА

*B. F. Агекян, Ю. А. Степанов*

Спектры фотolumинесценции экситонов в монокристаллах двуокиси олова изучены при межзонном импульсном возбуждении, определена зависимость от уровня возбуждения интенсивности линий экситонов — свободных и связанных на кластерах кислородных вакансий. По спектрам образцов с низкой и высокой концентрацией кислородных вакансий расшифрована структура спектра фононных реплик, определяемая в основном *LO*-фононами. Показано, что в использованных экспериментальных условиях эффективная температура экситонов значительно превышает температуру кристаллической решетки.

Край фундаментального поглощения тетрагонального кристалла  $\text{SnO}_2$  находится в ближней ультрафиолетовой области, однако для него типична высокая концентрация дефектов донорного типа, делающая двуокись олова материалом с типичными полупроводниковыми свойствами. Пленки  $\text{SnO}_2$  используются как прозрачные проводящие электроды и компоненты солнечных диодных ячеек разнообразной конструкции [1-3]. В последнее время проводящие пленки  $\text{SnO}_2$  наносятся на подложки при получении структур из аморфного гидрогенезированного кремния *a-Si : H* и твердых растворов на его основе с целью избежать накопления заряда в процессе выращивания структур при разложении  $\text{SiH}_4$  и его аналогов в тлеющем радиочастотном разряде [4]. Одним из специфических применений кристаллов  $\text{SnO}_2$  является их использование как высокочувствительных газовых сенсоров, для чего была разработана специальная технология [5, 6]. Охлажденные кристаллы  $\text{SnO}_2$  являются высокочувствительными приемниками в далекой ИК-области, что было продемонстрировано в опытах по циклотронному резонансу [7].

На свойства  $\text{SnO}_2$  можно воздействовать введением примесей, но, как правило, решающее значение имеет степень отклонения от стехиометрического состава — в двуокиси олова всегда имеет место недостаток кислорода. Развито много способов выращивания пленок и кристаллов  $\text{SnO}_2$ : пиролиз [8], окисление [9], выращивание из расплава, газотранспортный метод [10, 11] и т. д. Наиболее крупные монокристаллы с линейными размерами до 3 см удается получить методом медленного окисления чистого олова [9], но с точки зрения спектроскопических свойств наилучшие результаты дает реакция



при высокой температуре, где транспортирующими агентами для паров четыреххлористого олова и воды являются инертные газы [12].

Спектроскопические исследования тетрагональной двуокиси олова хорошего качества заслуживают внимания в двух аспектах. Она представляет интерес как кристалл группы рутила с ярко выраженным экситонным спектром, позволяющим точно определить параметры электронных состояний. Не менее важно

значение фундаментальных свойств для оценки качества конкретных практических используемых образцов.

Монокристаллы  $\text{SnO}_2$  были выращены по методике [12] с некоторыми усовершенствованиями; они имели естественные грани, поверхность которых не подвергалась дополнительной обработке. Люминесценция при температуре жидкого гелия возбуждалась импульсным азотным лазером, энергия квантов которого на 50 мэВ превышает ширину запрещенной зоны  $\text{SnO}_2$ , и регистрировалась с помощью двойного монохроматора и системы типа Boxcar.

## 1. Спектр экситонного поглощения

Экситонная серия спектра поглощения в  $\text{SnO}_2$  (рис. 1, а) впервые наблюдалась в работе [13], вскоре было установлено, что нижнее состояние экситона с квантовым числом  $n=1$ , наиболее важное для исследования люминесценции, является квадрупольным типа  $1S$  с симметрией  $\Gamma_3^+$  [14]. Это позволяет классифицировать межзонный переход как прямой запрещенный и определить симметрию волновых функций валентной зоны  $\Gamma_3^+$  и зоны проводимости  $\Gamma_1^+$ . При увеличении концентрации вакансий кислорода (ВК), например, прогревом в вакууме происходит уширение и диссоциация верхних экситонных уровней, ниже  $1S$ -экситона появляется новая линия поглощения, которую следует интерпретировать как экситон, локализованный на одиночной ВК (линия I на рис. 1, б).

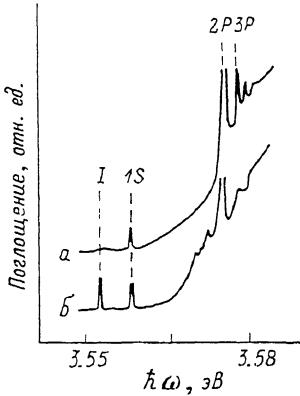


Рис. 1. Спектр поглощения кристаллов  $\text{SnO}_2$  с низкой (а) и высокой (б) концентрацией вакансий кислорода (ВК).  $1S$ ,  $2P$ ,  $3P$  — линии поглощения свободного экситона; I — линия экситона, локализованного на одиночной ВК.  $T = 2$  К.

## 2. Бесфоновая люминесценция

При сравнительно низком уровне возбуждения  $W$  в излучении невосстановленного образца с хорошей стехиometрией наблюдается только  $1S$ -линия свободного экситона (СЭ), при увеличении  $W$  появляется целая серия линий, которые естественно отнести к экситонам, локализованным на одиночной ВК (линия I на рис. 2, резонансная с линией I в поглощении) и на кластерах, состоящих из двух и более близких ВК (линии II—IV на рис. 2).<sup>1</sup> Наблюдение дискретных серий линий люминесценции, сходящихся в длинноволновую сторону, теоретически интерпретировано в работе [15], где показано, что кластеры дефектов (в нашем случае ВК) некоторых строго определенных конфигураций оказываются резонансными, т. е. обладают гигантским сечением захвата экситонов, и именно они в основном формируют структуру бесфоновой люминесценции. На рис. 2 приведены спектры люминесценции и их разложение на лоренцевские контуры типа

$$f(E) = AC^2[(E - B)^2 + C^2]^{-1},$$

где  $A$  — пищевая интенсивность,  $B$  — энергия максимума,  $C$  — полуширина контура.

Интенсивности СЭ  $I_{\text{СЭ}}$  и локализованного экситона (ЛЭ)  $I_{\text{ЛЭ}}$  пропорциональны соответственно  $W^{0.45}$  и  $W^{1.15}$ , т. е. при увеличении  $W$  отношение  $I_{\text{ЛЭ}}/I_{\text{СЭ}}$

<sup>1</sup> Линия I' имеет, видимо, иное происхождение.

быстро растет (рис. 3). Сверхлинейная зависимость  $I_{\text{ЛЭ}} (W)$  может быть объяснена тем, что ВК захватывают экситоны лишь в определенном зарядовом состоянии, доля которого увеличивается с ростом оптического возбуждения (переза-рядка ВК фотоносителями).

При увеличении концентрации ВК линия излучения СЭ ослабляется и исчезает, в спектре ЛЭ происходит уширение структуры и перераспределение интенсивности в пользу более глубоких состояний. В случае больших концент-

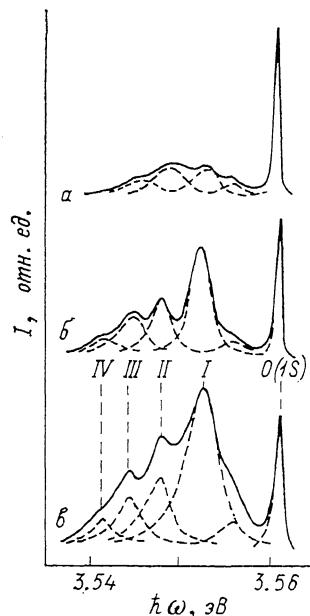


Рис. 2. Нормированные по максимуму спектры бесфононной люминесценции SnO<sub>2</sub> при уровнях возбуждения  $W = 2 \cdot 10^5$  (a),  $1 \cdot 10^6$  (b) и  $5 \cdot 10^6$  Bt/cm<sup>2</sup> (c).

$O$  — линия свободного экситона  $1S$ ;  $I$  — экситон, локализованный на одиночной ВК ('см. спектр поглощения на рис. 1);  $II$ — $IV$  — линии экситонов, локализованных на кластерах из двух и более ВК. Штриховые линии — разложение спектра на симметричные лоренцевские контуры.  $T = 2$  K.

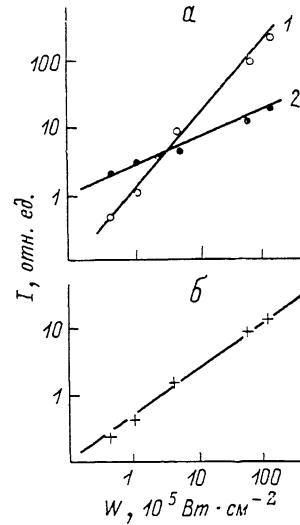


Рис. 3. Влияние уровня оптического возбуждения  $W$  на бесфононное излучение SnO<sub>2</sub>.  
a — интегральная интенсивность люминесценции локализованных экситонов  $I_{\text{ЛЭ}}$  (1) и свободных экситонов  $I_{\text{СЭ}}$  (2); б — отношение  $I_{\text{ЛЭ}}/I_{\text{СЭ}}$ .  $T = 2$  K.

раций ВК имеет место миграция экситонов по одиночным ВК и кластерам, когда «резонансные» кластеры оказываются неактуальными и распределение экситонов по уровням дефектов приближается к термодинамически равновесному.

Температурная зависимость спектра бесфононного излучения экситонов в SnO<sub>2</sub> с малой концентрацией ВК не является стандартной. При повышении температуры образца до 20 K происходит резкое затухание СЭ и линий ЛЭ II—IV и усиление линии I ЛЭ. Этот результат можно объяснить тем, что температурное уширение спектра СЭ уменьшает эффективность их захвата на «резонансные» кластеры [15], в результате чего доминирующими в излучательной рекомбинации оказываются уровни одиночных ВК, концентрация которых на порядки превышает концентрацию кластеров. Что же касается столь быстрой температурной деградации излучения СЭ, то этот, заслуживающий внимания результат в настоящей работе не рассматривается.

### 3. Люминесценция с участием фононов

Элементарная ячейка решетки типа рутила содержит две формульные единицы и соответственно имеет 15 оптических ветвей. В таблице приведены результаты теоретического расчета колебаний решетки  $\text{SnO}_2$ , данные анализа спектра ИК-отражения [16], а также результаты изложенного ниже рассмотрения фононных повторений экситонной люминесценции.

Энергии и симметрии фононов решетки кристалла

Симметрия фононов	Энергии фононов, см <sup>-1</sup>		
	расчет [18]	ИК-отражение	люминесценция
$\Gamma_3^+$	100		
$\Gamma_4^-$	140		
$\Gamma_5^{-(1)} TO$	236	244	
$\Gamma_5^{(1)} LO$	268	276	275
$\Gamma_5^{-(2)} TO$	297	293	
$\Gamma_5^{-(2)} LO$	377	366	366
$\Gamma_2^+$	398		
$\Gamma_5^+$	441		
$\Gamma_4^-$	505		
$\Gamma_1^-$	512	477	
$\Gamma_1^+$	646		
$\Gamma_5^{-(3)}$	651	618	618
$\Gamma_1^-$	687	705	
$\Gamma_5^{-(4)}$	750	770	750
$\Gamma_4^+$	752		

В поглощении и термопоглощении СЭ [17, 18] наблюдается структура, соответствующая непрямым переходам с участием фононов  $TO$  ( $295 \text{ см}^{-1}$ ) и  $LO$  ( $376 \text{ см}^{-1}$ ), так что следует ожидать их сильного проявления в люминесценции. Вообще, согласно правилам отбора, при симметрии  $1S$ -экситона  $\Gamma_3^+$  дипольно разрешенными оказываются процессы с участием фононов, имеющих симметрию  $\Gamma_4^-$  и  $\Gamma_5^-$ . Отметим причины, затрудняющие идентификацию фононных повторений: сложность бесфононной структуры, приводящая к наложению фононных спектров ее компонент; изменение относительных вкладов в люминесценцию компонент бесфононного спектра при изменении уровня возбуждения; возможность различия величин экситон-фононного взаимодействия для СЭ, экситонов, локализованных на одиночных ВК, и экситонов, локализованных на кластерах ВК.

Мы анализировали люминесценцию экситонов на основе трех качественно отличающихся спектров. На рис. 4 спектр *a* соответствует слабому возбуждению невосстановленного образца  $\text{SnO}_2$  с низкой концентрацией ВК, когда в бесфононной люминесценции доминирует СЭ. Спектр *b* получен на том же образце, но при более сильном возбуждении, когда интенсивности СЭ и ЛЭ приблизительно одинаковы. Наконец, спектр *c* относится к восстановленному образцу, в излучении которого линия  $O$  (1 СЭ) практически отсутствует. В первом спектре фононные повторения должны в основном относиться к СЭ — это полосы ( $I-1$ ), ( $I-2$ ), ( $I-3$ ), являющиеся репликами излучения  $1s$  СЭ с рождением  $LO$ -фононов  $\Gamma_5^{-(1)}$  ( $279 \text{ см}^{-1}$ ),  $\Gamma_5^{-(2)}$  ( $366 \text{ см}^{-1}$ ),  $\Gamma_5^{-(4)}$  ( $750 \text{ см}^{-1}$ ) (см. таблицу). Сопоставляя спектры на рис. 4, можно заключить, что полосы ( $I-1$ ), ( $I-2$ ), ( $I-3$ ) и ( $II-1$ ), ( $II-2$ ), ( $II-3$ ) являются аналогичными фононными повторяю-

щими линий ЛЭ I и II, полоса II—5 относится к фонону  $\Gamma_5^{-(3)}$  ( $618 \text{ cm}^{-1}$ ). Что касается самой длинноволновой полосы, то она является сложной; кроме вкладов в нее, отмеченных на рис. 4, возможны вклады разрешенных по симметрии трехфононных процессов, например, с участием фонона  $\Gamma_5^{-(1)}$ . Таким образом, можно сделать вывод, что спектр люминесценции экситонов в  $\text{SnO}_2$  может быть в основном описан как излучательная аннигиляция свободных и локализованных на ВК экситонов — бесфононная и с участием продольных оптических фононов. Из значительных деталей спектра неясно происхождение полосы, отмеченной на рис. 4, в штриховой стрелкой.

Отнесение полос  $(I-1)$ ,  $(I-2)$ ,  $(I-3)$  к фононным повторениям СЭ подтверждается исследованием их формы. Известно, что в фононных повторениях лю-

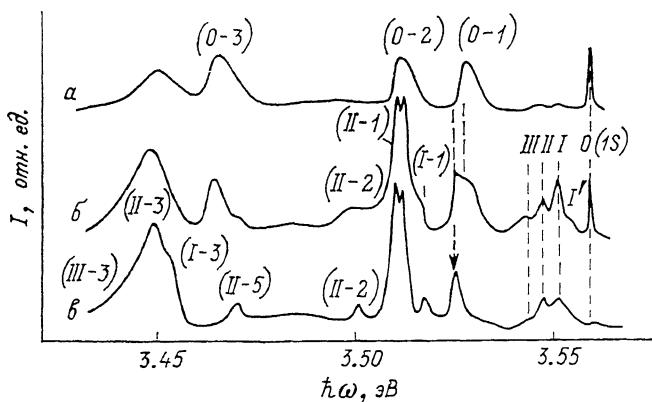


Рис. 4. Спектры экситонной люминесценции кристаллов  $\text{SnO}_2$ : образец с низкой концентрацией ВК при мощности оптического возбуждения  $W=10^5$  (α),  $10^6$  Вт/см<sup>2</sup> (β) и образец с высокой концентрацией ВК при  $W=10^7$  Вт/см<sup>2</sup> (γ).  $T=2$  К.

метрии трехфононных процессов, например, с участием фонона  $\Gamma_5^{-(1)}$ . Таким образом, можно сделать вывод, что спектр люминесценции экситонов в  $\text{SnO}_2$  может быть в основном описан как излучательная аннигиляция свободных и локализованных на ВК экситонов — бесфононная и с участием продольных оптических фононов. Из значительных деталей спектра неясно происхождение полосы, отмеченной на рис. 4, в штриховой стрелкой.

Отнесение полос  $(I-1)$ ,  $(I-2)$ ,  $(I-3)$  к фононным повторениям СЭ подтверждается исследованием их формы. Известно, что в фононных повторениях лю-

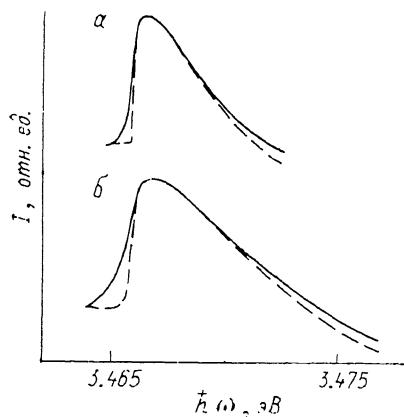


Рис. 5. Полоса излучения свободного экситона с участием  $LO$ -фонона ( $750 \text{ cm}^{-1}$ ) при  $W=10^5$  (α) и  $10^7$  Вт/см<sup>2</sup> (β).

Спектры нормированы по максимуму излучения. Штриховые линии — аппроксимация полосы максвелловскими контурами, соответствующими температурам 20 (α) и 30 К (β).  $T=2$  К.

минесценции СЭ проявляются экситоны с ненулевыми импульсами, и если величина экситон-фононного взаимодействия слабо зависит от импульса экситона, а дисперсия фонона невелика, то по форме контура полосы можно установить кинетическое распределение экситонов. Аппроксимация полосы максвелловским контуром с энергетической зависимостью типа

$$E^{1/2} \exp(-E/k_B T) dE$$

позволяет определить степень отклонения распределения экситонов от термодинамически равновесного и, если это отклонение невелико, измерить температуру экситонов  $T_s$ . Мы выбрали полосу  $(I-3)$ , которая слабо перекрывается со спектром ЛЭ, и установили, что ее коротковолновое крыло хорошо описы-

вается максвелловским контуром (рис. 5). Оказалось, что в наших экспериментальных условиях  $T_s$ , сильно отличается от температуры решетки,<sup>2</sup> равной 2 К, — уровням возбуждения  $10^5$  и  $10^7$  Вт/см<sup>2</sup> соответствуют  $T_s=20$  и 30 К.

Авторы благодарят С. И. Силего за участие в эксперименте и А. Тибулевича за постоянную техническую помощь.

### С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Peaker A. R., Horsley B. // Rev. Sci. Instrum. 1971. V. 42. N 12. P. 1825—1827.
- [2] Ghost A. K., Fishman C., Feng T. // J. Appl. Phys. 1979. V. 50. N 5. P. 3454—3458.
- [3] Kato N., Kanda T., Yasuda K., Yoshida A., Arizumi T. // Phys. St. Sol. (a). 1977. V. 42. N 2. P. 769—777.
- [4] Perrin J., Takeda Y., Hirano N., Matsuura H., Matsuda A. // Japan. J. Appl. Phys. 1989. V. 28. N 1. P. 5—11.
- [5] Pink H., Treitinger L., Vité L. // Japan. J. Appl. Phys. 1980. V. 19. N 3. P. 513—517.
- [6] Reddy M. H. M., Jowalekar S. R., Chandorkar A. N. // Thin Solid Films. 1989. V. 169. N 1. P. 117—126.
- [7] Ortenberg M., Link J., Helbig R. // J. Opt. Soc. Am. 1977. V. 67. N 4. P. 968—971.
- [8] Haitjema H., Woerlee G. F. // Thin Solid Films. 1989. V. 169. N 1. P. 1—16.
- [9] Takizawa T., Sakurai T. // Japan. J. Appl. Phys. 1973. V. 12. N 9. P. 1323—1326.
- [10] Kunkle H. F., Kohnke E. E. // J. Appl. Phys. 1965. V. 36. N 4. P. 1489—1492.
- [11] Marley J. A., Macavoy T. C. // J. Appl. Phys. 1961. V. 32. N 7. P. 2504—2508.
- [12] Nagasawa M., Shionoya S., Makishimo S. // Japan J. Appl. Phys. 1965. V. 4. N 3. P. 195—202.
- [13] Nagasawa M., Shionoya S. // Phys. Lett. 1966. V. 22. N 3. P. 409—411.
- [14] Агекян В. Ф. // Опт. и спектр. 1970. Т. 29. № 4. С. 741—744.
- [15] Агекян В. Ф., Герчиков Л. Г., Харченко В. А. // ЖЭТФ. 1987. Т. 92. № 5. С. 1770—1781.
- [16] Katiyar R. S., Dawson P., Hargreave M. M., Wilkinson G. R. // J. Phys. C. 1971. V. 4. N 15. P. 2421—2437.
- [17] Агекян В. Ф., Орешникова Л. В., Ширяпов И. П. // ФТТ. 1974. Т. 16. № 9. С. 2473—2475.
- [18] McRoberts R. D., Fonstad C. G., Hubert D. // Phys. Rev. B. 1974. V. 10. N 9. P. 5213—5219.

НИИ физики Санкт-Петербургского  
государственного университета

Поступило в Редакцию  
23 августа 1991 г.

---

<sup>2</sup> Об отсутствии нагревания кристалла световыми импульсами свидетельствует отсутствие сдвига и уширения линии 1 СЭ. В нашем эксперименте усредненная по времени мощность возбуждения не превышала единиц Вт/см<sup>2</sup>.